

南通深南サーキット株式会社

情報開示と自己監視案

一、 企業概要

1. 概要

会社名：南通深南サーキット株式会社
統一社会信用コード：913206123212589858

法定代表者：周進群
業種：電子回路製造

住所：南通高新区希望路 168 号
敷地面積：324,407m²

連絡先：許東輝
電話番号：17321585471
電子メール：xudhnt@scc.com.cn

主な生産設備：エッチングマシン、メッキライン、ブラウニングラインなど

主な製品と規模：

南通深南サーキット株式会社（以下、『南通深南』と略称）は、主に高精度、高密度、高信頼性の多層プリント回路基板の製造を中心とするハイテク企業であり、製品は通信バックプレーン、システム回路基板、マイクロウェーブ RF 回路基板、リジッドフレキシブル回路基板、組み込みコンポーネント回路基板、二次電源回路基板、パワーアンプ回路基板などがあり、通信、医療、自動車、産業制御などの各分野に広範に利用されています。

2. 環境影響評価と承認

南通深南は、要求通りに、南通深南建設プロジェクトの環境影響評価を有資格の第三者に委託し、南通市通州生態環境局の評価と承認に合格し、相応適切な環境評価承認と検査結果報告を取得しました。

3. 汚染予防施設の建設状況南通深南サーキット株式会社は、世界一流の三大廃棄物処理技術を導入、廃水処理システムを構築し、廃水各汚染項目の基準満足を保証しています。

廃水処理システムの主な処理プロセスは以下の通り：

一般洗浄廃水 → 化学反応 + 物理沈降 → 南通溯天工業污水处理廠

有機複合廃水→錯体の化学破壊+物理沈降→生化学分解→南通溯天工業污水处理廠

含シアン廃水→二次シアン分解酸化→錯化廃水

現像脱膜廃液→酸分析＋物理沈降→錯化廃水

ニッケル含有銀含有廃水→ フェントン酸化→管状膜→樹脂吸着→錯化廃水

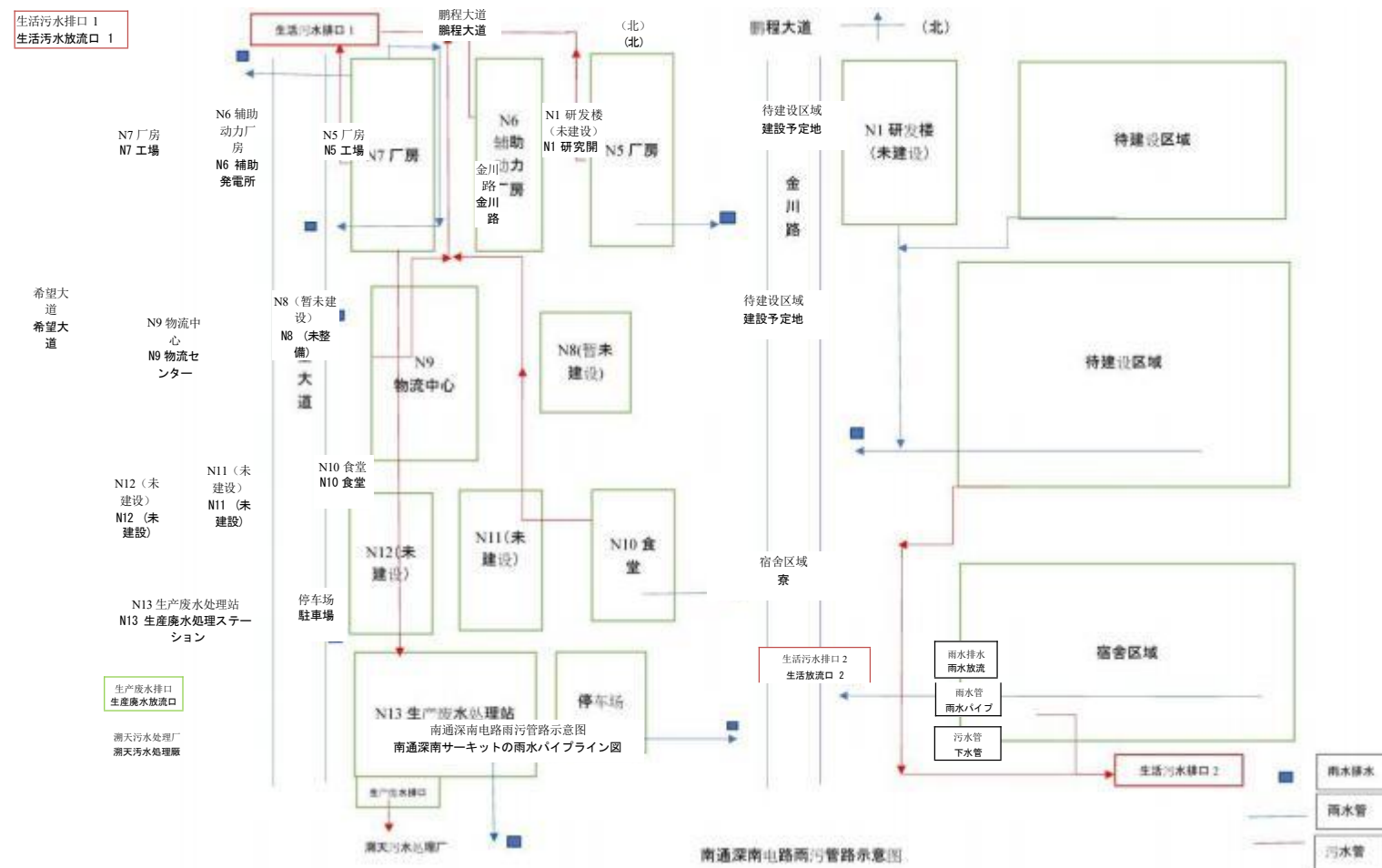
廃ガス生成部では、酸塩基廃ガスは酸塩基吸収法を採用して、廃ガス中の汚染物質を除去し、有機廃ガスは『水噴霧＋活性炭吸着』のプロセスを採用して汚染物質を除去し、粉塵はフィルター・プレートの粉塵除去プロセスを採用して汚染物質を除去します。廃ガス処理には、自動投薬とインテリジェント監視システムが装備され、高い自動化水準を実現しています。

4. 汚染物質の放出

南通深南汚染物質放出許可証により、塩化水素、硫酸ミスト、シアン化水素などのプロセス廃ガスの放出基準は、『電気鍍金汚染物質放出基準』（GB21900-2008）表 5 の指定基準に準拠しています。揮発性有機化合物、粒子状物質、ホルムアルデヒド、窒素酸化物は『大気汚染物質総合放出抑制基準』（GB16297-1996）表 2 の 2 次基準に準拠しています。アンモニア、硫化水素は『臭気汚染物質放出基準』（GB14554-93）に準拠しています。

廃水パイプ接続の廃水中の総銀放出量は、『電気鍍金汚染物質放出基準』（GB 21900-2008）表 2 の要件に準拠し、COD、アン

モニア態窒素、全窒素、全銅、全ニッケルは、南通高新区溯天工業污水处理廠の接続基準に準拠し、その他の指標は『污水総合放出基準』（GB8978-1996）表 4 の 3 次基準に準拠しています。工場全体の廃水放流図は以下の通り：



本資料は、深南サーキットが所有しており、無断流布禁止です。

5.環境保全緊急計画

南通深南は要求通りに、第三者機関に委託して環境緊急事態 対応計画を制定し、専門家の審査に合格し、南通市通州生態環境局に登録しました。

二、自己監視案

1. 監視箇所D配置工場全体D污染源D監視箇所、監視項目、監視頻度は下表の 通り：

汚染源区分	放流口名	監視内容	汚染物質名	監視施設	手動監視のサンプリング方法と個数	手動監視の頻度
-------	------	------	-------	------	------------------	---------

本資料は、深南サーキットが所有しており、無断流布禁止です。

廃ガス	FQGL-01	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	リングエルマンの黒さ	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/年
			窒素酸化物	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/月
			二酸化硫黄	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/年
			微粒子	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/年
	FQGL-02 FQGL-02	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道	リングエルマンの黒さ	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/年

		万又压力、煙道万又体積	室素酸化物	手動	非順次寸ン了yン 少 少甘く匕古 3 個	1 回/月
			二酸化硫黄	手動	非順次寸ン了yン 少 少甘く匕古 3 個	1 回/年
			微粒子	手動	非順次寸ン了yン 少 少甘く匕古 3 個	1 回/年
	FQGL-03 FQGL-03	煙道万又流速、煙道万又温度、煙道万又压力、煙道万又体積	yン斤Ⅳ▽ンΦ黒冬	手動	非順次寸ン了yン 少 少甘く匕古 3 個	1 回/年
			室素酸化物	手動	非順次寸ン了yン 少 少甘く匕古 3 個	1 回/月

			二酸化硫黄	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/年
			微粒子	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/年
	FQN7-1 FQN7-1	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	塩化水素	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
			硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN7-2 FQN7-2	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年

		ガス圧力、煙道ガス体積				
FQN7-5 FQN7-5	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	シアン化水素	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年	
FQN7-3 FQN7-3	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	ホルムアルデヒド	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年	
		硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年	

	FQN7-4 FQN7-4	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
	FQN7-6 FQN7-6	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
	FQN7-7 FQN7-7	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
	FQN5-9 FQN5-9	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道	揮発性有機化合物	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年

		ガス圧力、煙道ガス体積				
	FQN7-8 FQN7-8	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN7-13 FQN7-13	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN7-9 FQN7-9	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年

	FQN5-1 FQN5-1	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	揮発性有機化合物	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
	FQN12-3 FQN12-3	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
	FQN12-5 FQN12-5	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
	FQN12-9 FQN12-9	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道	硫酸ミスト	手動	非連続采样 至少 3 个 非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年

		ガス圧力、煙道ガス体積				
	FQN12-6 FQN12-6	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	揮発性有機化合物	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN7-12 FQN7-12	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	揮発性有機化合物	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN7-11 FQN7-11	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	揮発性有機化合物	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年

	FQN12-7 FQN12-7	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	シアン化水素	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQ N12-1 FQ N12-1	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN12-8 FQN12-8	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN12-15 FQN12-15	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年

		ガス圧力、煙道ガス体積				
	FQN12-17 FQN12-17	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	微粒子	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
	FQN12-10 FQN12-10	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	塩化水素	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
	FQN12-16 FQN12-16	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	塩化水素	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年

	FQN12-2 FQN12-2	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN12-4 FQN12-4	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN12-11 FQN12-11	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	揮発性有機化合物	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN12-12 FQN12-12	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道	揮発性有機化合物	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年

		ガス圧力、煙道ガス体積				
	FQN12-13 FQN12-13	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	揮発性有機化合物	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN12-14 FQN12-14	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	揮発性有機化合物	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN11-1 FQN11-1	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	塩化水素	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
			硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年

					個	
	FQN11-2 FQN11-2	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	アンモニア（アンモニアガス）	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
	FQN5-3 FQN5-3	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
	FQN5-2 FQN5-2	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年

	FQN5-4 FQN5-4	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	シアン化水素	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN5-5 FQN5-5	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN5-6 FQN5-6	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	アンモニア（アンモニアガス）	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN5-11 FQN5-11	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道	ホルムアルデヒド	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年

		ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN5-13 FQN5-13	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN5-14 FQN5-14	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN5-15 FQN5-15	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年

	FQN5-17 FQN5-17	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	微粒子	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN3-1 FQN3-1	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	微粒子	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN5-10 FQN5-10	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	揮発性有機化合物	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN5-12 FQN5-12	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道	揮発性有機化合物	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年

		ガス圧力、煙道ガス体積				
	FQN5-16 FQN5-16	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
	FQN5-7 FQN5-7	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	塩化水素	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
	FQN5-8 FQN5-8	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	塩化水素	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年

	FQN7-14 FQN7-14	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	微粒子	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN7-10 FQN7-10	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	揮発性有機化合物	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN6-1 FQN6-1	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN6-3 FQN6-3	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道	塩化水素	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年

		ガス圧力、煙道ガス体積				
	FQN6-2 FQN6-2	煙气流速,煙気温度,煙気圧力,煙気量 煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	アンモニア（アンモニアガス）	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	FQN13-2 FQN13-2	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道ガス圧力、煙道ガス体積	硫化水素	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
			硫酸ミスト	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年
	N13-1 N13-1	煙道ガス流速、煙道ガス温度、煙道	アンモニア（アンモニアガス）	手動	非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/半年

		ガス圧力、煙道ガス体積	硫化水素	手動	非順次サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個	1 回/半年
廃水	生産廃水放流口	流量	pH 値	自動	混合サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個の混合サンプル	自動監視装置が破損した場合は、 <u>1</u> 日 <u>4 回以上</u> の手動監視を採用し、 <u>間隔を 6 時間以内に</u> 設置する必要があります。
			浮遊物質	手動	混合サンプリング 少なくとも <u>3</u> 個の混合サンプル	1 回/月

			化学的酸素需要量	自動	混合サンプリング 少なくとも <u>3個</u> の混合サンプル	自動監視装置が破 損した場合は、 <u>1</u> <u>日 4 回以上</u> の手動 監視を採用し、 <u>間</u> <u>隔を 6 時間以内に</u> <u>設置する必要があ</u> <u>ります。</u>
			TOC	手動	混合サンプリング 少なくとも <u>3個</u> の混合サンプル	1 回/月
			陰イオン界面活性 剤	手動	混合サンプリング 少なくとも <u>3個</u> の 混合サンプル	1 回/月
			総銅	手動		1 回/月

					混合サンプリング 少なくとも3個の 混合サンプル	
			全窒素（N で計 算）	手動	混合サンプリング 少なくとも3個の 混合サンプル	1 回/月
			アンモニア態窒素 （NH ₃ -N）	自動	混合サンプリング 少なくとも3個の 混合サンプル	自動監視装置が破 損した場合は、 <u>1</u> <u>日 4 回以上</u> の手動 監視を採用し、 <u>間</u> <u>隔を 6 時間以内に</u> <u>設置する必要があります。</u>
			全リン（P で計 算）	手動	混合サンプリング 少なくとも3個の 混合サンプル	1 回/月

			フッ化物（F-で計算）	手動	混合サンプリング 少なくとも <u>3個</u> の 混合サンプル	1 回/月
			石油類	手動	混合サンプリング 少なくとも <u>3個</u> の 混合サンプル	1 回/月
			総シアン化物	手動	混合サンプリング 少なくとも <u>3個</u> の 混合サンプル	1 回/月
	第一種汚染物質放 流口	流量	総ニッケル	手動	混合サンプリング 少なくとも <u>3個</u> の 混合サンプル	1 回/日
			総銀	手動	混合采样 至少 3 个混合样 混合サンプリング 少なくとも <u>3個</u> の 混合サンプル	1 回/日

その他の自己監視および記録情報

汚染源区分・監視区分	登録番号/監視箇所	名称	監視内容	汚染物質名	監視施設	施設が設置、運行、保守の管理要件を満たしているかどうかを自動的に監視します。	手動監視のサンプリング方法と回数	手動監視の頻度
废气 廃ガス	MF0066			揮発性有機化合物	手動			1 回/年

			風速、気温、湿度、風向				非順次サンプリング 少なくとも 3 個	
	工場境界		風速、風向、気温、湿度	ホルムアルデヒド	手動		非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/年
				揮発性有機化合物	手動		非順次サンプリング 少なくとも 3 個	1 回/年
廃水	DW001	生産廃水放流口	流量	流量	自動	はい	その他	その他
	DW017	第一種汚染物質放流口	流量	流量	自動 自動	はい	その他	その他

土壌	監視箇所	監視箇所		pH 値 pH 値	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年
				総水銀	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3

								年、第二種 監視箇所 表層は1回/ 年
				総カドミウム	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1回/年、深 層1回/3 年、第二種 監視箇所 層は1回/年

				六価クロム	<u>手動</u>		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年
				総ヒ素	<u>手動</u>		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3

								年、第二種 監視箇所 表層は1回/ 年
				なまり 総鉛 <u>総レッド?</u> <u>lead?</u>	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1回/年、深 層1回/3 年、第二種 監視箇所 表層は1回/ 年

				総ニッケル	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年
				総銅	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3

								年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年
				シアン化物	手動		その他	一类单元监测点位表层 1 次/年，深层 1 次/3 年，二类单元监测点位表层 1 次/年 第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年

				フェノール	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年
				2-クロロフェノール	手動		その他	一类单元监 测点位表层 1 次/年，深 层 1 次/3 年，二类单 元监测点位 表层 1 次/年 第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3

								年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年
				クロロメタン	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年

				ジクロロメタン	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年
				クロロホルム	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3

								年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年
				テトラクロロメ タン（四塩化炭 素）	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年

				1, 1-ジクロロエタン	手動		その他	第一種監視箇所 表層 1 回/年、深層 1 回/3 年、第二種監視箇所 表層は 1 回/年
				1, 2-ジクロロエタン	手動		その他	第一種監視箇所 表層 1 回/年、深層 1 回/3

								年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年
				1,1,1- トリクロ ロエタン	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年

				1,1,2-トリクロ ロエタン	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1回/年、深 層1回/3 年、第二種 監視箇所 表層は1回/ 年
				1,1,2,2-テトラ クロロエタン	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1回/年、深 層1回/3

								年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年
				1,2-ジクロロプロ パン	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年

				塩化ビニル	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年
				1,1-ジクロロエ チレン	手動		その他	第一種監視 箇所 表層 1 回/年、深 層 1 回/3

								年、第二種 監視箇所 表層は 1 回/ 年
				1,2-ジクロロエ チレン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年

				1,2-ジクロロエチレン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1回/年、深 層1回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は1回/ 年
				トリクロロエチレン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1回/年、深 層1回/3

								年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年
				テトラクロロエ チレン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年

				トルエン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年
				エチルベンゼン	手動		その他	第一種監視 地点の表層 1 回/年、深 層 1 回/3

								年、第二種 監視箇所の 表層は1回/ 年
				0-キシレン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1回/年、深 層1回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は1回/ 年

				m-キシレン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1回/年、深 層1回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は1回/ 年
				クロロベンゼン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1回/年、深 層1回/3

								年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年
				1,2-ジクロロベ ンゼン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年

				1,4-ジクロロベンゼン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1回/年、深 層1回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は1回/ 年
				ニトロベンゼン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1回/年、深 層1回/3

								年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年
				スチレン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年

				ベンゾ[a]ピレン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1回/年、深 層1回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は1回/ 年
				インデン [1,2,3-cd]ピレン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1回/年、深 層1回/3

								年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年
				ベンズ[a]アン トラセン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年

				ジベンゾ (a, h) アントラセン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年
				ベンゾ [b] フル オランテン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1 回/年、深 層 1 回/3

								年、第二種 監視箇所の 表層は1回/ 年
				ベンゾ[k]フル オランテン	手動		その他	第一種監視 地点の表層 1回/年、深 層1回/3 年、第二種 監視地点の 表層は1回/ 年

				ナフタレン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年
				アニリン	手動		その他	第一種監視 箇所の表層 1 回/年、深 層 1 回/3

							年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年
				石油炭化水素	手動	その他	第一種監視 箇所の表層 1 回/年、深 層 1 回/3 年、第二種 監視箇所の 表層は 1 回/ 年
地下水	監視井戸	监测点位 監視箇所		pH 値	手動	その他	一类监测点 位 1 次/半 年，二类监 测点位 1 次/ 年 第 1 種監視 箇所 1 回/半

								年、第 2 種 観測地点 1 回/年
				彩度	手動		その他	一类监测点 位 1 次/半 年，二类监 测点位 1 次/ 年 第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				濁度	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年

				匂いと味	手動		その他	第 1 種監視箇所 1 回/半年、第 2 種監視箇所 1 回/年
				総溶解固形分	手動		その他	第 1 種監視箇所 1 回/半年、第 2 種監視箇所 1 回/年
				全硬度	手動		その他	

								第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				目視可能物質	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				陰イオン界面活 性剤	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年

				アルミニウム	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				ナトリウム	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				総水銀	手動		その他	

								第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				総カドミウム	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				六価クロム	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年

				総ヒ素	手動		その他	第 1 種監視箇所 1 回/半年、第 2 種監視箇所 1 回/年
				総鉛	手動		その他	第 1 種監視箇所 1 回/半年、第 2 種監視箇所 1 回/年
				総ニッケル	手動		その他	

								第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				総銅	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				総亜鉛	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年

				総マンガン	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				総鉄	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				総銀	手動		その他	

								第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				総セレン	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				アンモニア態窒 素 (NH ₃ -N)	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年

				亜硝酸塩	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				硝酸塩（N で計 算）	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				シアン化物	手動		その他	

								第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				フッ化物（F-で 計算）	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				硫化物	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年

				塩化物（Cl-で 計算）	手動		その他	第1種監視 箇所 1 回/半 年、第2種 監視箇所 1 回/年
				硫酸塩（SO42- で計算）	手動		その他	第1種監視 箇所 1 回/半 年、第2種 監視箇所 1 回/年
				揮発性フェノー ル	手動		その他	

				フェノール	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				クロロホルム	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				テトラクロロメ タン（四塩化炭 素）	手動		その他	

								第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年
				ジアミノトルエ ン	手動		その他	第 1 種監視 箇所 1 回/半 年、第 2 種 監視箇所 1 回/年

各汚染項目の放出基準限界値

汚染物質の分類	監視箇所	汚染項目	実行基準	基準限界値	単位
廃ガス	工場屋上	硫酸ミスト	『電気鍍金汚染物質放出基準』（GB21900-2008）	30	3mg/m3
		塩化水素		30	3mg/m3
		シアン化水素		0.5	3mg/m3
		揮発性有機化合物	『大気汚染物質総合放出基準』（GB16297-1996）	50	3mg/m3
		微粒子		120120	3mg/m3
		ホルムアルデヒド		2525	3mg/m3
		窒素酸化物		200200	3mg/m3

本資料は、深南サーキットが所有しており、無断流布禁止です。

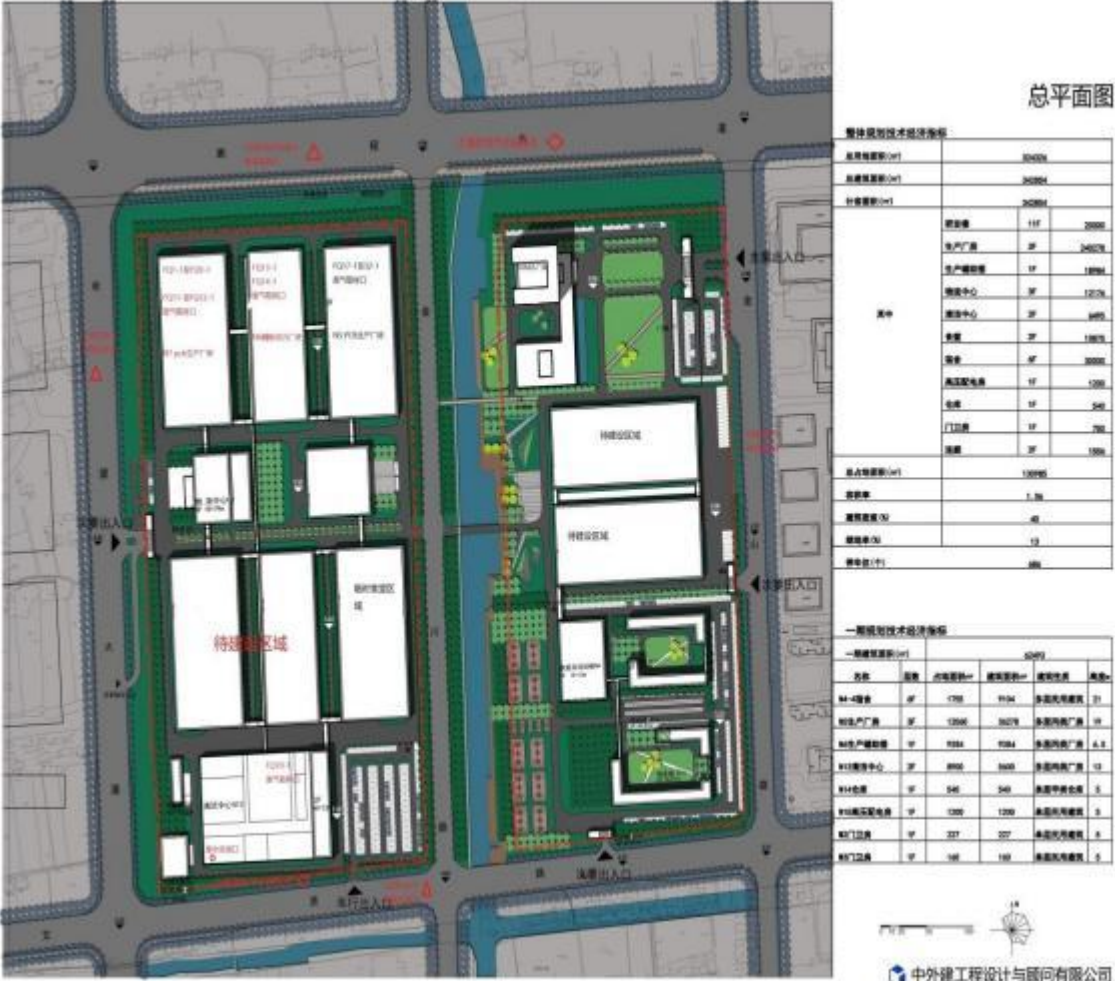
		窒素酸化物	『ボイラーの大気汚染物質放出基準』（GB 13271-2014）	50	3mg/m3
		二酸化硫黄		50	3mg/m3
		リンゲルマンの黒さ濃度		1	3mg/m3
		微粒子		20	mg/m3
	工場境界	硫化水素	『悪臭汚染物質放出基準』（GB14554-93）	0.06	mg/m3
		アンモニア		1.5	mg/m3
		臭気濃度	大気汚染物質総合放出基準GB16297-1996	20	/
		微粒子		1	mg/m3
		シアン化水素		0.024	mg/m3
		揮発性有機化合物		4	mg/m3

		硫酸ミスト		1.2	mg/m3
		塩化水素		0.2	mg/m3
廃ガス	工場境界	揮発性有機化合物	揮発性有機化合物ランダム放 出基準 GB 37822-2019	6	mg/m3
		NMHC非メタン総炭化水素		20	mg/m3
境界ノイズ	工場境界	ノイズ	『企業境界内環境騒音放出基準』 (GB12348-2008)	昼間：65	dB
				夜間：55	
廃水	産業廃水の放流口	pH値	『総合廃水放流基準』（GB8978-1996）	6-9	
		浮遊物質	『総合廃水放流基準』（GB8978-1996）	400	mg/L
		化学的酸素需要量	高新区溯天工業污水处理廠の廃水パイプ接続基準	250	mg/L

			総銅	高新区溯天工業污水处理廠の 廃水 パイプ接続基準	0.5	mg/L
			アンモニア態窒素	高新区溯天工業污水处理廠の 廃水 パイプ接続基準	35	mg/L
			総リン	『総合廃水放流基準』（GB8978-1996）	8	mg/L
			総シアン化物	『総合廃水放流基準』（GB8978-1996）	1.0	mg/L
			総銀	『電気鍍金汚染物質放出基準』（GB 21900-2008）表 2	0.3	mg/L
廃水	第一種汚染物質見 本採集口		総ニッケル		0.5	mg/L

四、監視結果の開示

1. 監視結果の開示期限監視データは、監視終了ごとに公開されます
2. 監視結果の開示方法公開才不仁付、深南寸一牛>ト株式会社Φ公式 Web寸入ト仁口少入ンL τ<挖会的。
3. 監視時間2023年小己監視開始校才。
4. 監視案の実施この監視案は、2023年1月1日に実施されます。
5. 監視箇所分布図



本資料は、深南サーキットが所有しており、無断流布禁止です。